



(12)

## CERERE DE BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. cerere: **a 2009 00945**

(22) Data de depozit: **18.11.2009**

(41) Data publicării cererii:  
**30.05.2011** BOPI nr. **5/2011**

(71) Solicitant:

- INCDCP-ICECHIM,  
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.202,  
SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO;
- CHIMCOLOR SRL BUCUREȘTI,  
STR. VAPORUL LUI ASSAN NR.4,  
SECTOR 2, BUCUREȘTI, B, RO

(72) Inventatori:

- GHIOCA PAUL NICULAE,  
ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 297, BL. 15A,  
SC. B, AP. 77, SECTOR 3, BUCUREȘTI, B,  
RO;

- SPURCACIU BOGDAN NOROCEL,  
ALEEA ARINIȘ NR.2A, BL.A39C, SC.4,  
AP.59, SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO;
- IANCU LORENA,  
BD. ALEXANDRU OBREGIA NR.17, BL.M5,  
SC.A, ET.6, AP.54, SECTOR 4,  
BUCUREȘTI, B, RO;
- PARSU DUMITRU,  
STR. VAPORUL LUI ASSAN NR.4,  
SECTOR 2, BUCUREȘTI, B, RO;
- PARSU LENUȚA,  
STR. VAPORUL LUI ASSAN NR.4,  
SECTOR 2, BUCUREȘTI, B, RO;
- NOVAC OVIDIU ADRIAN, STR.  
HĂȚIȘULUI NR.2, BL.H4, AP.11, SECTOR 2,  
BUCUREȘTI, B, RO

### (54) PROCEDEU PENTRU OBȚINEREA AGENȚILOR DE MASCARE ȘI PROTECȚIE A METALELOR SUPUSE UZINAJULUI CHIMIC

(57) Rezumat:

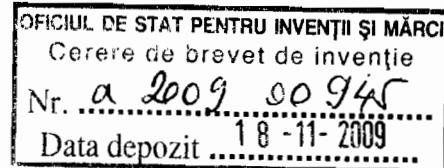
Invenția se referă la un procedeu pentru obținerea unor agenți de mascare și protecție a metalelor supuse uzinajului chimic. Procedeul conform inventiei constă din dizolvarea în tetracloretilenă la o concentrație de 8,5...8,6% a unui amestec format din 100 părți dibloc-copolimer stiren-butadienic stelat cu un conținut de 30,3% polistiren, având masa moleculară de 180.000 g/mol și 50...60 părți, preferabil 55 părți

dibloc-copolimer stiren-butadienic cu un conținut de 70% polistiren, având masa moleculară de 80.000 g/mol sau 45...55 părți, preferabil 50 părți dibloc-copolimer stiren butadienic cu un conținut de 70% polistiren, având masa moleculară de 100.000 g/mol.

Revendicări: 2

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).





## PROCEDEU PENTRU OBTINEREA AGENTILOR DE MASCARA SI PROTECTIE A METALELOR SUPUSE UZINAJULUI CHIMIC

Inventia de fata se refera la un procedeu de obtinere a agentilor de mascare si protectie a metalelor supuse uzinajului chimic pe baza de solutii de bloc-copolimeri stiren-butadienici SBS si dibloc-copolimeri stiren-butadienici BS in solventi clorurati neinflamabili.

Produsele destinate mascurii metalelor in vederea uzinarii chimice sunt, de regula, solutii de polimeri cu diferite adasuri de aditivi pentru reglarea viscozitatii si de umpluturi organice sau minerale pentru modelarea aderenetei la metale si a elasticitatii peliculei depuse. Din dozajul diferit al acestor materiale, acompaniat de varierea naturii si concentratiei solventului se ajunge in final la reteta optima a produsului de mascare, care trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte :

- Sa formeze o pelicula continua, uniforma, fara incluziuni de aer pe intreaga suprafață depusa pentru masarea reperului metalic ;
- Pelicula polimera trebuie sa prezinte o adezivitate controlata intre anumite limite, astfel nu trebuie sa prezinte valori foarte mari pentru ca dupa imprimarea modelului prin taiere, partea ce trebuie decupata sa poata fi desprinsa fara mari dificultati. Totusi se cere o buna aderența pentru ca pelicula ramasa in urma decuparii sa protejeze perfect si permanent metalul acoperit in timpul transportului, manevrarii si efectuarii uzinzului chimic.
- Pelicula depusa trebuie sa prezinte o elasticitate controlata, adevarata scopului propus, nu foarte ridicata pentru a nu conduce la deformari in timpul imprimarii modelului prin taiere, dar cu valori medii capabile sa-i asigure o buna stabilitate dimensionala care sa preintimpine deformarea ei pe parcursul transportului reperelor si al uzinajului chimic.
- Solutia de mascare nu trebuie sa prezinte fenomenul de variere a concentratiei pe verticala, in baile de depunere pe reperele metalice, pentru a nu schimba grosimea si compozitia peliculei depuse, ceea ce ar produce dificultati la sablonare, cu influente negative asupra calitatii.

Conform acestor cerinte, se recomanda ca proprietatile solutiilor de mascare sa se incadreze in urmatorii parametrii:

-Viscozitatea cinematica la 25 °C (Zahn, cupa 5): 30-50 sec.

Pelicula de mascare depusa din aceasta solutie prezinta urmatoarele proprietati:

- Rezistenta la traciune: minim 5 Mpa
- Alungirea la rupere: minim 300 %
- Rezistenta la jupuire: minim 2.5 daN/25 mm

Agentul de mascare se utilizeaza si pentru realizarea de pelicule protectoare pentru cuvele si sistemul de prindere si sustinere al reperelor supuse operatiunilor de galvanizare (nickelare, cadmiere, zincare, argintare, etc).

De regula, un agent de mascare are in compositie trei componente: componenta elastomera, componenta ranforsanta si solventul.

Drept componenta elastomera a agentului de mascare se utilizeaza cauciucul natural si o serie de cauciucuri sintetice: cauciuc stiren-butadienic (SBR), polibutadienic (BR), nitrilic (NBR), policloroprenic, siliconic, etc. Utilizarea acestor cauciucuri in producerea agentilor de mascare prezinta dezavantajul ca dupa depunerea peliculei de mascare este necesara vulcanizarea acesteia, faza consumatoare de energie si de materialele componente ale retetei de vulcanizare cum ar fi peroxizi, sulf si diversi agenti de vulcanizare.

Inventia de fata inlatura acest dezavantaj prin utilizarea drept componenta elastomera in producerea agentului de mascare a bloc-copolimerilor stiren-butadienici (SBS) care nu necesita vulcanizare, deoarece acesti elastomeri prezinta o reticulare fizica virtuala datorita structurii secentiale a blocurilor componente, incompatibile din punct de vedere termodinamic. Lipsa fazei de vulcanizare, in cazul utilizarii bloc-copolimerilor stiren-butadienici in producerea agentului de mascare conduce la avantaje economice, agentul de vulcanizare avind un pret de cost mai redus prin eliminarea materialelor componente ale retetei de vulcanizare. Utilizatorul are avantajul scurtarii timpului de mascare cu minim 3 ore, prin eliminarea fazei de vulcanizare.

Utilizarea bloc-copolimerilor stiren-butadienici in locul altor elastomeri pentru obtinerea agentilor de mascare prezinta si alte avantaje:

- bloc-copolimerilor stiren-butadienici prezinta o solubilitate mai mare in solventi clorurati (peste 35% in perclorat de etilenă), in comparatie cu alti elastomeri;
- bloc-copolimerilor stiren-butadienici formeaza, din solutie, pelicule uniforme si aderente pe suprafetele metalice a caror elasticitate poate fi in mare masura reglata, conform necesitatilor, din compositia lor, prin varierea raportului dintre componenta polistirenica rigida si componenta polibutadienica elastica;

- dupa efectuarea operatiunilor de decupare si uzinaj chimic, peliculele de mascare se recupereaza si prin dizolvare in solventul clorurat se reface cu usurinta solutia de mascare, asigurindu-se reciclarea sistemului de protectie, practic fara pierderi de deseuri tehnologice, eliminindu-se poluarea mediului. In cazul peliculelor vulcanizate reciclarea nu este posibila datorita insolubilitatii peliculelor.

Componenta ranforsanta a agentului de mascare poate fi minerala sau organica: silicati, argile, talc, diferite rasini sintetice. Un dezavantaj major al utilizarii acestor materiale de ranforsare il constituie incompatibilitatea sau compatibilitatea limitata a lor cu componenta elastomera, fapt ce conduce la separarea (depunerea) ranforsantilor, fenomenul fiind amplificat de diferența de densitate, de regula mai mare decit a elastomerilor. Aceasta separare a fazelor componente din solutia de mascare conduce la aparitia unui gradient de densitate si de concentratie pe verticala in baile de mascare. In acest caz peliculele de mascare depuse pe reperele metalice, in special pe cele de dimensiuni mai mari, prezinta variatii nedorite atit ale grosimii, cit si a compositiei, fenomen perturbator in realizarea sablonarii precise a modelului de uzinat si a desprinderii uniforme a portiunilor de pelicula care trebuie decupata.

Inventia inlatura acest dezavantaj prin utilizarea ca material ranforsant a unui dibloc-copolimer stiren-butadienic cu continut ridicat de polistiren, care prezinta o densitate apropiata de a acestora, si are o buna compatibilitate cu bloc-copoliomerii stiren-butadienici.

**Exemplul 1.** Intr-un recipient cu capacitatea de 1,5 l, prevazut cu agitare se introduce 1600 g de tetracloretilena, 100g de bloc-copolimer stiren-butadienic stelat cu un continut de 30,3 % polistiren avind masa moleculara de 180000 g/mol, 50 g de dibloc-copolimer stiren-butadienic cu un continut de 70 % polistiren avind masa moleculara de 80000 g/mol si 1,5 g de antioxidant 2,6-ditert-butil-4-metilsenol . Amestecul se agita pina la dizolvarea completa a componentilor, obtinindu-se solutia de mascare care are urmatoarele proprietati:

- Viscozitatea cinematica la 25 °C (Zahn, cupa 5): 38-42 sec.
- Continut in solide: 8,5-8,6 %.

Pelicula de mascare depusa din aceasta solutie prezinta urmatoarele proprietati:

- Rezistenta la tractiune: minim 7,2 Mpa
- Alungirea la rupere: minim 650 %
- Rezistenta la jupuire: minim 4,4 daN/25 mm

**Exemplul 2.** . Intr-un recipient cu capacitatea de 1,5 l, prevazut cu agitare se introduc 1655 g de tetracloretilena, 100g de bloc-copolimer stiren-butadienic stelat cu un continut de 30,3 % polistiren avind masa moleculara de 180000 g/mol, 55 g de dibloc-copolimer stiren-butadienic cu un continut de 70 % polistiren avind masa moleculara de 80000 g/mol si 1,5 g de 2,6-ditert-butil-4-metilfenol. Amestecul se agita pina la dizolvarea completa a componentilor, obtinindu-se solutia de mascare care are urmatoarele proprietati:

- Viscozitatea cinematica la 25 °C (Zahn, cupa 5): 36-40 sec.
- Continut in solide: 8,5-8,6 %.

Pelicula de mascare depusa din aceasta solutie prezinta urmatoarele proprietati:

- Rezistenta la traciune: minim 7,0 Mpa
- Alungirea la rupere: minim 600 %
- Rezistenta la jupuire: minim 4,1 daN/25 mm

**Exemplul 3.** . Intr-un recipient cu capacitatea de 1,5 l, prevazut cu agitare se introduc 1710 g de tetracloretilena, 100g de bloc-copolimer stiren-butadienic stelat cu un continut de 30,3 % polistiren avind masa moleculara de 180000 g/mol, 60 g de dibloc-copolimer stiren-butadienic cu un continut de 70 % polistiren avind masa moleculara de 80000 g/mol si 1,5 g de 2,6-ditert-butil-4-metilfenol. Amestecul se agita pina la dizolvarea completa a componentilor, obtinindu-se solutia de mascare care are urmatoarele proprietati:

- Viscozitatea cinematica la 25 °C (Zahn, cupa 5): 33-37 sec.
- Continut in solide: 8,5-8,6 %.

Pelicula de mascare depusa din aceasta solutie prezinta urmatoarele proprietati:

- Rezistenta la traciune: minim 6,6 Mpa
- Alungirea la rupere: minim 540 %
- Rezistenta la jupuire: minim 3,5 daN/25 mm

**Exemplul 4.** . Intr-un recipient cu capacitatea de 1,5 l, prevazut cu agitare se introduc 1550 g de tetracloretilena, 100g de bloc-copolimer stiren-butadienic stelat cu un continut de 30,3 % polistiren avind masa moleculara de 180000 g/mol, 45 g de dibloc-copolimer stiren-butadienic cu un continut de 70 % polistiren avind masa moleculara de 100000 g/mol si 1,5 g de 2,6-ditert-butil-4-metilfenol. Amestecul se agita pina la dizolvarea completa a componentilor, obtinindu-se solutia de mascare care are urmatoarele proprietati:

- Viscozitatea cinematica la 25 °C (Zahn, cupa 5): 38-42 sec.

- Continut in solide: 8,5-8,6 %.

Pelicula de mascare depusa din aceasta solutie prezinta urmatoarele proprietati:

- Rezistenta la tractiune: minim 7,4 Mpa
- Alungirea la rupere: minim 650 %
- Rezistenta la jupuire: minim 4,6 daN/25 mm

**Exemplul 5.** Intr-un recipient cu capacitatea de 1,5 l, prevazut cu agitare se introduce 1600 g de tetracloretilena, 100g de bloc-copolimer stiren-butadienic stelat cu un continut de 30,3 % polistiren avind masa moleculara de 180000 g/mol, 50 g de dibloc-copolimer stiren-butadienic cu un continut de 70 % polistiren avind masa moleculara de 100000 g/mol si 1,5 g de 2,6-ditert-butil-4-metilsenol. Amestecul se agita pina la dizolvarea completa a componentilor, obtinindu-se solutia de mascare care are urmatoarele proprietati:

- Viscozitatea cinematica la 25 °C (Zahn, cupa 5): 36-40 sec.
- Continut in solide: 8,5-8,6 %.

Pelicula de mascare depusa din aceasta solutie prezinta urmatoarele proprietati:

- Rezistenta la tractiune: minim 7,0 Mpa
- Alungirea la rupere: minim 600 %
- Rezistenta la jupuire: minim 4,2 daN/25 mm

**Exemplul 6.** Intr-un recipient cu capacitatea de 1,5 l, prevazut cu agitare se introduce 1655 g de tetracloretilena, 100g de bloc-copolimer stiren-butadienic stelat cu un continut de 30,3 % polistiren avind masa moleculara de 180000 g/mol, 55 g de dibloc-copolimer stiren-butadienic cu un continut de 70 % polistiren avind masa moleculara de 100000 g/mol si 1,5 g de 2,6-ditert-butil-4-metilsenol. Amestecul se agita pina la dizolvarea completa a componentilor, obtinindu-se solutia de mascare care are urmatoarele proprietati:

- Viscozitatea cinematica la 25 °C (Zahn, cupa 5): 34-38sec.
- Continut in solide: 8,5-8,6 %.

Pelicula de mascare depusa din aceasta solutie prezinta urmatoarele proprietati:

- Rezistenta la tractiune: minim 6,7 Mpa
- Alungirea la rupere: minim 550 %
- Rezistenta la jupuire: minim 3,7 daN/25 mm

2009 - 00945 --  
18 -11- 2009

16

**Referinte bibliografice**

USP: 4247361 , 7122079 , 7282240 , 7510978 , 7560038

Henkel Technical Information Bulletin **TURCOFORM MASK : 537-42 HT si 540-R**

## REVENDICARI

1. Procedeu pentru obtinerea agentilor de mascare si protectie a metalelor supuse uzinajului chimic pe baza de solutii de bloc-copolomeri stiren-butadienici si dibloc-copolimeri stiren-butadienici, **caracterizat prin aceea ca** agentul de mascare se obtine prin dizolvarea in tetracloretilena la o concentratie de 8.5-8.6 % a unui amestec de 100 parti de bloc-copolimer stiren-butadienici stelat cu un continut de 30.3 % polistiren avind masa moleculara de 180000 g/mol si 50 - 60 parti, preferabil 55 parti, de dibloc-copolimer stiren-butadienici cu un continut de 70 % polistiren avind masa moleculara de 80000 g/mol.

2. Procedeu pentru obtinerea agentilor de mascare si protectie a metalelor supuse uzinajului chimic pe baza de solutii de bloc-copolomeri stiren-butadienici si dibloc-copolimeri stiren-butadienici, **caracterizat prin aceea ca** agentul de mascare se obtine prin dizolvarea in tetracloretilena la o concentratie de 8.5-8.6 % a unui amestec de 100 parti de bloc-copolimer stiren-butadienici stelat cu un continut de 30.3 % polistiren avind masa moleculara de 180000 g/mol si 45 - 55 parti, preferabil 50 parti, de dibloc-copolimer stiren-butadienici cu un continut de 70 % polistiren avind masa moleculara de 100000 g/mol.